

※課題番号 : F-12-KT-0106
 ※支援課題名 (日本語) : Si 流路加工
 ※Program Title (in English) : Development of magnetic fluid drive device
 ※利用者名 (日本語) : 藤井泰久、松本信子、岩本悠宏、山口貴裕
 ※Username (in English) : Yasuhisa Fujii, Nobuko Matumoto, Yuhiro Iwamoto, Takahiro Yamaguchi
 ※所属名 (日本語) : 株式会社 KRI 磁石材料研究室
 ※Affiliation (in English) : KRI, Inc. Magnetic Materials Laboratory

※概要 (Summary) :

Si 流路を加工する為に、フォトリソ工程に関する各種装置操作方法を教わり、各自操作した。(1日実習)

・レジスト現像装置など : 1.5H
 有機現像液型レジスト現像装置
 (株)カナメックス

※実験 (Experimental) :

利用装置

使用ウエハー

・φ4インチ Si ウエハー

使用フォトマスク

・200μm幅テストパターン流路 (KRI 持参)

・基板洗浄装置 : 1H

ウェハスピ洗浄装置

(株)カナメックス 製

<チャンバー内部の写真>



・厚膜レジスト塗布装置 : 1.5H

厚膜フォトレジスト用スピニング装置

ズース・マイクロテック(株) 製

・紫外線露光装置 : 2H

MA6

ズースマイクロテック(株) 製

※結果と考察 (Results and Discussion) :

フォトリソ工程の各種装置の操作方法をある程度習得できた。基板洗浄装置、厚膜レジスト塗布、レジスト現像装置については、ほぼ操作方法を習得した。

紫外線露光装置に関しては、特に両面露光の光軸合わせの理解度が低く、もう1度実習が必要。

※その他・特記事項 (Others) :

・今後の課題

フォトリソ工程の装置操作方法及びプロセス条件等を完全に理解・マスターしてから、Si 流路設計検討をおこなう。

共同研究者等 (Coauthor) :

同志社大学工学部山口研究室

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

なし

関連特許 (Patent) :

なし

